

技術解説

眞空熱處理와 新技術(I)

Vacuum Heat Treatment and New Technology

오 강 구

한국종합기계 공업로 사업부

I. 真空熱處理의 特徵

1. 「眞空」霧圍氣의 利點

熱處理爐內에서의 처리금속의 표면변화를 抑制하기 위하여, 從來에는 주로 分위기GAS 또는 鹽浴을 사용하였다. 그러나 산화, 탈탄, 침탄 등의 表面變化를 防止하기 위하여 爐氣관리에 신경을 쓰더라도 실제 조업시에는 약간의 表面變化는 피할 수가 없었다. 그래서 사용目的에 따라서는 酸洗, 切削, 研磨등에 의해 표면층을 除去할 필요가 있다. 따라서 이러한 결점을 보완하기 위해서는 爐내 분위기로서 진공을 사용하여 용이하게 표면변화를 방지함은 물론 酸化膜의 解離 및 處理金屬 中의 不純GAS成分의 除去도 가능하다. 이러한 意味로서, 「眞空」은 우월한 热處理분위기임에 틀림없다.

○ 진공을 분위기로하여 열처리에 利用하면 아래와 같은 利點이 있다.

(1) 열처리할 금속에 침입하는 物質이 없다.

- (2) 열처리할 금속중의 좋지 않은 不純GAS를 제거 할 수 있다.
- (3) 진공분위기는 다른 분위기 GAS에 비해 염가이다.
- (4) 열처리조작중에 적절한 진공으로 조작하기가 용이하다.
- (5) 진공배기의 의해 爐내의 不純GAS를 쉽게 배출 가능하다.

壓力과 露點

진공도와 상당하는 불순물 및 노점

眞空度 Torr	100	10	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
相當不純物量%	13.4	1.34	0.134	0.0134				
相當不純物量 (ppm)					13.4	1.34	0.134	0.0134
相當露點°C		+11	-18	-40	-59	-74	-88	-101

2. 真空熱處理와 雾圍氣熱處理의 比較

真 空 热 處 理	雾 围 气 热 處 理
<p>1. 热處理雾圍氣의 純度 가스雾圍氣의 純度를 나타내는 방법으로서 露點이 使用되지만 無酸化熱處理雾圍氣로서 크게 잡아 $-30\sim40^{\circ}\text{C}$程度이다. GAS BOMBE(액화가스는 제외)의 경우 $-40\sim45^{\circ}\text{C}$ 정도이다. 또한 活性일로미나 等으로 充分히 除去하여도 -60°C, 三酸化Lean통하여도 -75°C程度이다. 이에 비하여 真空爐는 10^{-4}Torr로서 -90°C, 10^{-1}Torr로서 -40°C 등, 高純度热處理雾圍氣가 簡單히, 그리고 erta 가로서 얻어지는 이점이 있다. 雾圍氣管理不要</p> <p>2. 光輝熱處理가 가능하다. 鋼을 酸化雾圍氣에서 加熱하면 表面은 酸化作用을 받아서 酸化하지만, 同時에 脱炭, 合金元素의 酸化消耗가 일어난다. 그것을 防止하기 위하여 不活性GAS를 使用하여 光輝熱處理를 하지만 GAS中에 포함되어 있는 미량의 酸化性GAS에 의해 酸化消耗가 일어난다. 真空爐에서는, 이러한 진공분위기에 의해 酸化하기 쉬운 金屬 및 合金에서도 쉽게 光輝熱處理가 가능하다. 處理溫度, 鋼種에 左右되지 않고 安定되고도 쉽게 光輝熱處理可能. 장시간 停爐後에도 즉시 操業可能</p> <p>3. 表面清淨效果 金屬表面에 附着 또는 吸着한 유기물은, 真空中에서 加熱하면 금속이 輝發한다. 一般的으로 有機物은 금속의 증가압보다 높기 때문에, 低溫에서 이作用이 일어나고, 연이어서 고온으로 되면 더욱더 금속의 解離反應, 脱GAS현상이 일어난다. 금속중에는 불순물원소(S P C₂등) 금속중에서는 높은 증기압에 속한다.)랑, 용해 및 열간압연중에 各種의 GAS가 용해흡수되고 있다. 이것은 금속이 갖고 있는 기계적성질을 저하시키고 있지만, 진공열처리를 행함으로 인하여 비교적 저전공도에서 증발이 일어나므로 처리물표면의 품질을 향상시킬 수 있다. 脫 Scale, 粒界酸化防止可能.</p> <p>4. 環境·衛生 최근 생활환경이 윤택해짐에 따라 住民의 環境에 대한 公害意識이 높아짐에 따라, 作業者の 安全衛生도 急速히 좋아져서 以前의 热處理工場의 Image를 一身한 工場으로 변모되고 있다. 真空熱處理는 時代의 趨勢에 맞추어서 이러한 면에서도 優位性을 갖고 있다. 無公害는 물론, 真空容器內의 作業이기 때문에 自動化한 爐는 热의 發散도 없고, 또한 GAS等에 의한 爆發의 危險性도 없이, 安全면에서도 勞動條件을大幅적으로 改善할 수가 있다. 爐殼溫度: 室溫 排GAS: N₂GAS</p> <p>真空熱處理의 問題點 1. 有效成分元素의 蒸發 真空熱處理의 缺點으로 有效成分元素의 蒸發이 있다. 合金의 蒸氣莊은 純金屬의 증기압보다 더욱더 높은 蒸氣莊을 갖고 있는 것으로 되어 있다. 蒸發을 防止하기 위해서는 0.1~1 Torr에서 不活性GAS를 送入하면서 壓力を Control하여 蒸發을 억제한다.</p>	<p>RX-GAS+炭化水素GAS N₂AS+ 또는 有機液剤 상시雾圍氣管理를 행한다.</p> <p>嚴密하게는 處理溫度와 鋼種(炭素慶度)에 따라 雾圍氣 Level의 變更이 必要. 長時間停爐後 SEASONING이 必要</p> <p>脫 Scale, 粒界酸化防止는 기대할 수 있다.</p> <p>爐殼溫度 $70^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 排GAS: N₂와 H₂, CO等 可燃GAS가 있음.</p> <p>在同의 現象은 없다.</p>

3. 真空熱處理와 鹽浴熱處理의 比較

真空熱處理와 鹽浴熱處理에서는 加熱의 設定條件(특히時間)을 變更할 必要가 있다. 바꾸어 말하면 真空爐는 輻射熱에 의한 加熱이고, 더욱이 多數의 處理材를 모아서 裝入하므로, 升溫中의 爐溫度에 대해 處理材溫度가 늦게 승온된다. 이 때문에 保持時間은 鹽浴爐에 비해 길게 된다.

또한 真空爐에서는 같은 크기, 같은 형상의 處理材만으로서 1 Charge량을 채우는 것은 불가능한 경우가 많아, 實操業에서는 多少의 크기 및 형상이 다른것을 동일 Charge로서 처리한다. 이경우 동일 Charge內의 처리물의 升溫速度에 차이가 나타나기 쉬우나, 烧入溫度直前의 豫熱을 충분히 하고, 그후 단시간에 烧入溫度까지 升溫하는 Heat cycle의 設定에 의해 急速升溫을 행한다. 그結果 處理材의 크기, 形狀에 차이가 있더라도 烧入溫度까지의 升溫差는 작아, 均一한 热處理가 可能하다.

항목	구분	真空熱處理	鹽浴處理		
1. 爐의 升溫	不 要	Salt 升溫 또는 前日부터 保持			
2. 處理材의 Set	Basket 또는 治具에 모아서 set한다. (作業容易)	1개~數개 단위로 set한다. (손이 많이 간다)			
3. 前處理	付着油의 洗淨 (도리크렌洗淨機等必要)	水分의 乾燥 (電氣爐等要)			
4. 處理溫度와 時間의 Set	溫度設定器 와 TIMER 또는 PROGRAM設定器 (事前設定)	溫度設定器에 의해 溫度設定. 時間은 操爐者가 管理(處理中에 管理要)			
5. 處理材의 裝 入	搬送機構上에 BA SKET를 Set한다.	直接鹽浴爐內에 裝入한다.			
6.	↑ 加 热 ↓ 冷 却 ↓ 抽 出	↑ 真空排氣 ↓ 豫熱×1~2段 ↓ 均 热 ↓ 冷 却 ↓ 抽 出	豫熱×1~2爐 ↓ 均熱×1爐 ↓ 抽 出 ↓ 油槽投入 ↓ 抽 出 (處理中조작不要)	豫熱×1~2爐 ↓ 均熱×1爐 ↓ 抽 出 ↓ 油槽投入 ↓ 抽 出 (處理中조작必要)	作業者에 의한 作業
7. 後 處 理	不 要	Salt 제거			

II. 真空의 基礎

I. 真空의 領域

真空의 領域

領域	壓力範圍	立 誉	代表의 PUMP	代表의 真空計	平均自由行程 (空氣, 150°C)
低真空	大氣壓~1 Torr	粘性流	油回轉PUMP	水銀MANOMETER 旦魯동 管真空計	50 μ 以下
中真空	1~10 ⁻³ Torr	中間領域	油回轉PUMP EJECTER PUMP MECHANICAL BOOSTERPUMP	마그라우트 真空計 PIRANI真空計 (油MANOMETER)	50 μ ~5 cm
高真空	10 ⁻³ ~10 ⁻⁷ Torr	分子流	擴散PUMP 分子PUMP	電離真空計 페닝 真空計	5 cm~500 m
超高真空	10 ⁻⁷ Torr以下	分子流	TRAP付擴散PUMP 스파타이온 PUMP	B-A 形真空計	500 m以上

2. 真空의 單位

真空壓力單位

壓 力	←높은		낮은→						
			←낮은(나쁜)					높은(좋은)→	
真空度									
真空壓力 Torr	1520		760	1	0.1	0.01	0.001	0.0001	0
mmHg			1		1×10 ⁻¹	1×10 ⁻²	1×10 ⁻³	1×10 ⁻⁴	1
(絕對壓) 水銀柱	▼	▼	■	■	■	■	■	■	▼
壓力 kg/cm ² (abs)	2		1	0.0013 (=1/760)					0
(絕對壓)	▼	▼	■						▼
一般壓力 kg/cm ² (G) (GAGE壓)	1		0	-0.9987					-1
mmH ₂ O (G)	10000		0	-9987					-10000
水柱			■						▼
PASCAL			1013.25	133.3			1 (=7.5×10 ⁻³ Torr)		0
Pa			▼	■			■		▼

壓力의 單位

	[Torr]	[μ Hg]	[μ bar]	[氣壓]	[kg/cm ² 重]	[psi]	[Pa]
1 Torr =1 mmHg	1	10^3	1.333 22 $\times 10^3$	1.315 79 $\times 10^{-3}$	1.359 51 $\times 10^{-3}$	1.933 7 $\times 10^{-1}$	1.333 22 $\times 10^2$
1 μ Hg = 10^{-3} Torr	10^{-3}	1	1.333 22	1.315 79 $\times 10^{-4}$	1.359 51 $\times 10^{-6}$	1.933 7 $\times 10^{-5}$	1.333 22 $\times 10^{-1}$
1 μ bar = 1 dyn/cm^2	7.500 6 $\times 10^{-4}$	7.500 6 $\times 10^{-1}$	1	9.869 72 $\times 10^{-7}$	1.019 72 $\times 10^{-6}$	1.450 3 $\times 10^{-5}$	10^{-1}
1 氣壓	760	7.60×10^5	1.0313 25 $\times 10^4$	1	1.033 23	1.469 5 $\times 10$	0.013 25 $\times 10^5$
1 kg/cm ² 重	7.355 6 $\times 10^2$	7.355 6 $\times 10^5$	9.806 65 $\times 10^5$	9.678 4 $\times 10^{-1}$	1	1.422 3 $\times 10$	9.806 65 $\times 10^4$
1 psi	5.175 5 $\times 10$	5.171 5 $\times 10^4$	6.894 8 $\times 10^4$	6.804 6 $\times 10^{-2}$	7.030 7 $\times 10^{-1}$	1	6.8948 $\times 10^3$
1 Pa (= 1 N/m^2)	7.500 6 $\times 10^{-3}$	7.500 6	10	9.869 2 $\times 10^{-6}$	1.019 72 $\times 10^{-5}$	1.450 3 $\times 10^{-4}$	1

流量의 單位

	[Torr · l/s]	[lusec]	[cc · atm/s]	[molecules/s]	[ucfh]
1 Torr · l/s	1	10^3	1.316	3.536×10^{16}	1.271×10^5
1 lusec = 1 l · μ Hg/s	10^{-1}	1	1.316×10^{-3}	3.536×10^{16}	1.271×10^2
1 cc · atm/s	7.6×10^{-1}	7.6×10^2	1	2.687×10^{19}	9.662×10^4
1 molecule/s	2.828×10^{-20}	2.828×10^{-17}	3.722×10^{-20}	1	3.596×10^{-15}
1 μ cfh = 1 μ Hg · ft ³ /h	7.866×10^{-6}	7.866×10^{-3}	1.035×10^{-3}	2.781×10^{14}	1

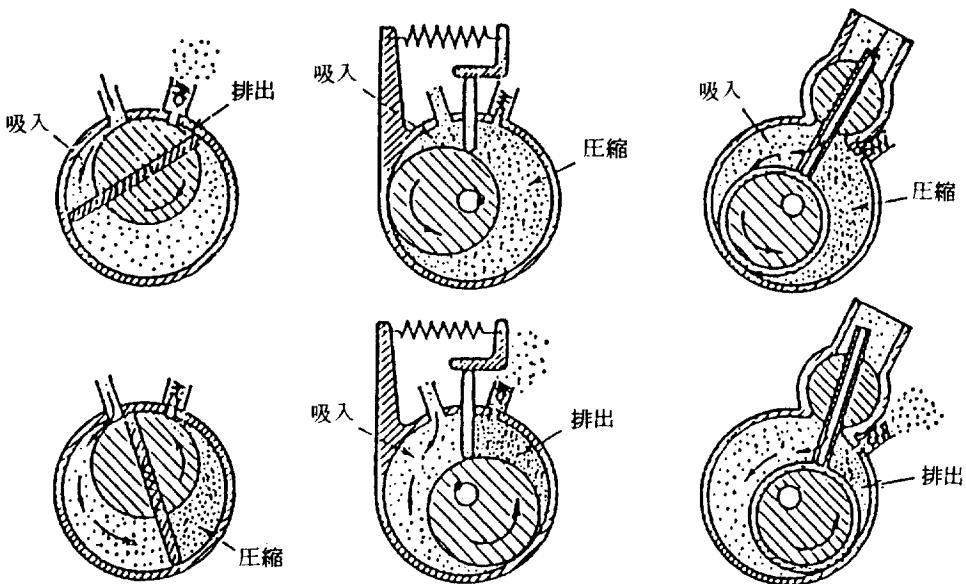
3. 真空 PUMP

1) 真空PUMP의 作動範圍

	PUMP	壓力 (Torr)
		10 ⁻⁸ 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁴ 10 ⁻² 1 10 ²
機械 PUMP	油回轉PUMP(1段)	-----
	油回轉PUMP(2段)	-----
	MECHANICAL BOOSTER	-----
蒸氣 PUMP	분자 PUMP(나이프 형)	-----
	水銀擴散PUMP	-----
	油擴散PUMP	-----
	油 EJECTER	-----
기타	STEAM EJECTER	-----
	케다이온 PUMP	-----
	크라이오 PUMP	-----
타	SUCTION(흡입)PUMP	-----

2) 油回轉 pump(Rotary pump)

眞空爐에는 반드시 부속되어 있는 pump로서 大氣壓에서 作動可能하고, 單獨으로 1 Pa($\sim 10^{-3}$ Torr) 까지 排氣가능한 代表的인 真空pump이다.



(a) 回転翼形

(b) CAM形

(c) 搖動 PISTON形

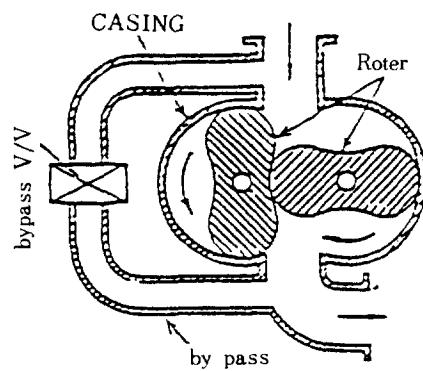
油回轉 PUMP의 구조와 배기하는 방법

3) Mechanical booster (Roots pump)

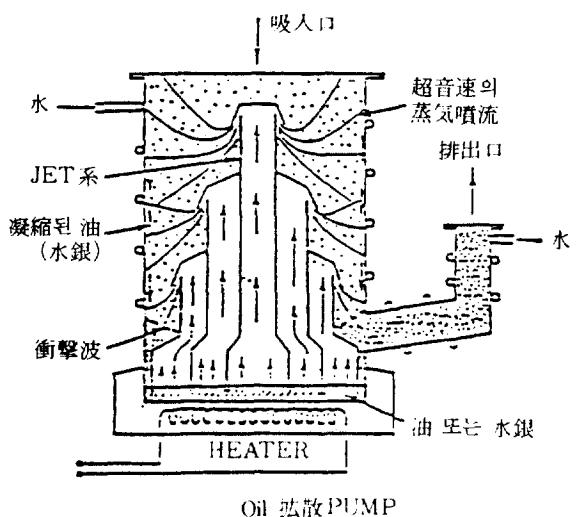
이 pump의 원리는 새로운 것이 아니라 오래전부터 Roots blower의 형태로서 송풍기로해서 사용되어 왔다. 그림과 같은 구조로서 2개의 Gear pump로 볼 수가 있다. 양쪽의 Roter는 서로 반대 방향으로 상당히 고속 (1000~3000 rpm)으로同期回轉하도록 되어 있다. Case와 Roter 및 Roter끼리는 접촉하지 않고 수 100μ 정도의 틈새를 유지한다. 그래서 기체가 이 틈새로 역류하는 것에 대항하므로써 고속회전의 Roter가 기체를 흡입구로부터 배출구로 보낸다. 이 pump에는 valve도 압축실도 없고, oil도 사용하지 않는다. 그렇더라도 회전부분의 대칭성이 좋기 때문에 작은 구동전력으로서 고속회전이 가능하고, 큰 배기속도가 얻어진다. 최대급은 대략 $20,000 \text{ m}^3/\text{h}$ (333000 l/min)이다.

4) Oil 확산 pump

Pump는 그림에 보인 바와같이 증기를 발생시키는 boiler, 증기를 분사하는 노즐 및 분사시킨 증기를 응축시키는 벽 등으로 구성되어 있다. 가느다란 노즐에서 초음속으로 분출한 증기는 내부 Energy의 대부분이 운동 Energy로 변환한 상태로 되며, 많은 분자는 점트方向의 속도성분이 압도적으로 많아지게 된다. 이 증기의 속도는 대략 $150\sim200 \text{ m/s}$ 이다. 이것에 대하여 예를 들면 공기의 분자의 평균속도는 실온에서 450 m/s 정도이다. 그래서, 이 점트에 떠다니는 공기의 분자는 무거운 증기분자와 충돌하면 증기분자쪽의 운동량이 10배정도 더 크므로 점트의 진행방향으로 끌려 된다. 그결과, 공기의 분자는 흡입구에서 배출구쪽으로 흘르게 되어 pump작용이 이루어진다.



MECHANICAL BOOSTER



Oil Diffusion PUMP

5) 各種 진공pump의 용도

眞空爐에 使用되는 真空pump의 用途와 特徵은

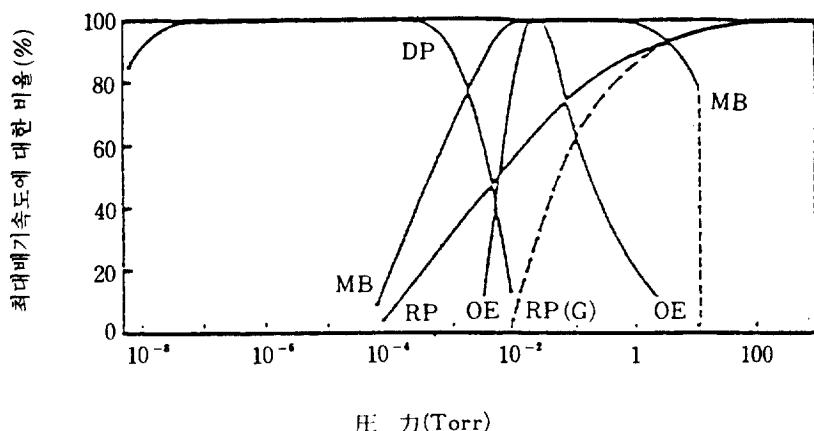
(1) 油回轉PUMP(RP)……모든 真空爐에는 부속되어 있지만 10 Torr 以下로 되면 排氣性能이 低下한다.

10^{-2} Torr 로서 操業하는 爐에는 MB와의 組合이 必要.

0.5 Torr 程度로서 操業하는 爐에서는 通常RP만으로 좋다.

(2) MECHANICAL BUSTER(MB)…… 30 Torr 付近에서 10^{-2} Torr 性能이 나오는 pump로서 보통의 금형, 공구장의 热處理爐에서는 RP+MB의 組合이 많다.

(3) 油擴散 pump(DP)…… $10^{-2}\sim10^{-6} \text{ Torr}$ 로서 使用하는 pump로서 特殊한 用途(예를 들면 Ti의 處理)의 경우에 使用 한다.



RP : 2단식 OIL 회전 Pump RP(G) : 2단식 GAS바라스트 OIL 회전 Pump
MB : Mechanical booster OE : OIL EDJECTOR Pump
DP : OIL 확산 Pump

각종 Pump에 있어서의 배기속도의 비교

4. 真空計

1) 各種真空計의 測定範圍

한마디로 真空이란 大氣壓에서 가까운 것과 超高真空이 있다. 最近은 그 範圍도 莊力으로 말하여 15 단계이상으로 불리워지며, 1종류의 진공계로서는 만족할 수 없도록 되어 있다.

Gauge Type	Approximate Range (x-axis)
U字管마노메타(수은)	-12 to 0
U字管마노메타(油)	-12 to 0
마크라우드真空計	-12 to 0
부르돈管真空計	-12 to 0
隔膜真空計	-12 to 0
파라니真空計	-12 to 0
熱電對真空計	-12 to 0
씨미스터真空計	-12 to 0
電離真空計	-12 to 0
B-A形真空計	-12 to 0
알파드론真空計	-12 to 0
펜닝真空計	-12 to 0
초고진공용마그네톤真空管	-12 to 0
쿠터센真空計	-12 to 0
점성真空計	-12 to 0

2) 真空爐에 使用하는 真空計

真空熱處理爐에 사용하는 真空計로서 일반적으로는 下記의 것이 使用된다.

(1) 브르동管式真空計……通常의 壓力計와 同形狀으로서

+莊 ↔ 大氣壓↔VAC의 測定

(2) 피라니真空計…… $20 \text{ Torr} \sim 10^{-3} \text{ Torr}$ 의 測定用

(3) 페닝真空計…… $10^{-3} \text{ Torr} \sim 10^{-6} \text{ Torr}$ 의 測定用

대표적인 진공계와 그 적용압력

名 称	原 理	精 度	壓力(Torr)									
			100	10	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}
Bloton管 真空計	壓力差에 의한 弹性变形을 利用한다.	數% ~ 數10%	[Redacted]									
RIRANI真空計	氣体分子에 의한 热伝導를 利用한다.	數10%	[Redacted]									
電 漂 真 空 計	熱電子에 의한 残留GAS의 電離作用을 이용한다.	10~20%	[Redacted]									
VEING真空計	磁場의 放電에 의한 ION 電流를 利用한다.	20~50%	[Redacted]									

III 真空熱處理爐

1. 개요

初期에는 雾圍氣中에서는 處理곤란한 特殊金屬, 예를 들면 티타늄, 지르코니움 및 合金의 燃鈍, 核燃料物質의 燃鈍, 半導體材料의 燃鈍 및 擴散處理等에 muffle型의 外熱式真空爐가 사용되어 왔다. Muffle型의 真空爐는 處理時間이 길면 또 高溫度의 操業에는 限界가 있어, 特殊金屬의 热處理에 머물러 왔다. 한편 航空機產業, 宇宙產業으로부터의 신뢰도가 높은 金屬热處理 및 Brazing에 對한 요구 때문에, 高溫에 견디는 内熱型真空爐가 開發되었지만 強制冷却裝置를 갖지 못해 一般의 金屬热處理를 하지 못하였다. 爐內에 不活性GAS를 導入하고 冷却fan으로 强制冷却을 행하는 1 실GAS 冷却式 真空爐가 開發되어서 热處理範圍는 넓어졌다. 燃鈍, Brazing뿐만이 아니고, 高速度鋼, ダイエス강, 마르텐사 이트계스텐레스강 등의 空氣燒入鋼의 热處理가 可能하게 되었다. 더욱이 油燒入真空爐가 開發되고부터는 構造用合金等의 油燒入鋼의 處理가 可能하게 되어 热處理鋼種은 廣範圍하게 되었다. GAS冷却에서도 冷却速度의 要求때문에 別室GAS冷却方式, 더욱더 冷却速度를 向上시키기 위하여 加莊GAS冷却方式으로 진전되었다. 또한

高生産性 高熱效率의 要求때문에 半續式真空爐가 開發되었다.

또한 表面處理로서 真空浸炭의 技術이 開發되어, 肌燒鋼의 浸炭뿐만 아니라 스텐레스鋼의 浸炭處理可能한 真空浸炭爐가 開發되어, 高品質의 浸炭處理가 가능하도록 되었다.

한편 鋼의 热處理만이 아니고, 알루미늄의 Brazing, 燃鈍, 磁性材料의 热處理, 티타늄 等의 活性金屬의 热處理에 있어서도 그와 같은 真空爐의 發展은 괄목할 만한 것이다.

2. 真空爐에 있어서의 材料冷却方法

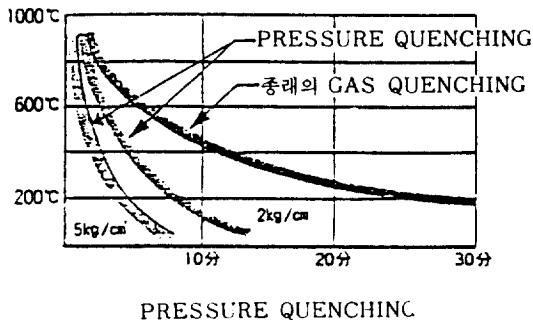
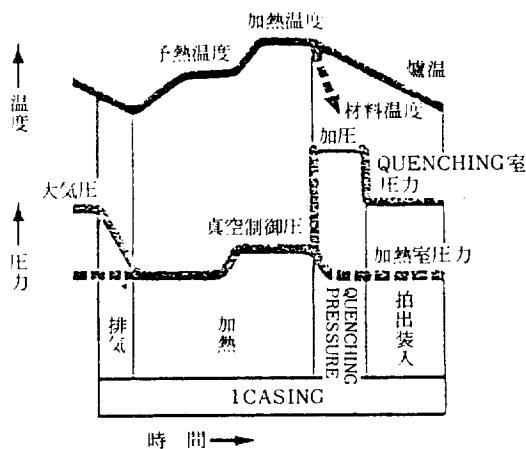
(GAS冷却)

冷却用GAS의 選擇, 冷却速度의 제어를 容易하게 할 수 있다. 특히 Press-Quench를 적용하면 廣範圍한 GAS冷却速度가 얻어진다.

高速度鋼, ダイエス강, 마르텐사이트계스텐레스강 등의 急冷, 各種金屬의 소둔, Brazing, 燃結등에 널리 이용되고 있다.

[OIL Quench]

加熱室을 Quench oil의 증기로 오염시키지 않고, 別室에서 烧入한다. HOT OIL QUENCH의 경우, 180°C도 可能하다. 低合金鋼, 軸受鋼, 合金工具鋼의 油燒入에 널리 사용되고 있다.



3. 真空燒鈍爐

Cu, Al, Ti, Zr, Mo, W 等 團體金屬 및 合金의 烧鈍, SUS, Be-Cu 合金의 時效硬化處理와 電子管材料인 Ni 및 그 合金의 脫 GAS燒鈍에도 真空이 이용된다.

1) Cu의 烧鈍爐

光輝面을 얻기위해 必要한 真空度는 1 Torr以下이면 좋다.

燒鈍溫度는 200~650°C이면 좋으므로 후술하는 低溫真空爐(寫真4-3)가 자주 利用된다.

2) 炭素鋼 및 SUS의 烧鈍爐

大氣燒鈍後의 酸洗脫 Scale의 工程을 省略하기 위한 真空爐로서는 10^{-2} Torr정도의 真空度가 必要하다. 真空PURGE+霧圍氣處理의 組合이 많고, 代表例로서

SUS 440 線材의 豎形燒鈍爐를 寫真 3-1에서 보여준다.

3) Al의 烧鈍爐

10^{-4} Torr정도로 排氣後, 真空加熱 또는 雾圍氣GAS를 導入하여 加熱한다.

또 MUFFLE을 使用하여, 雾圍氣GAS가 惡影響을 받지 않도록 하고 있다. (寫真 3-2)

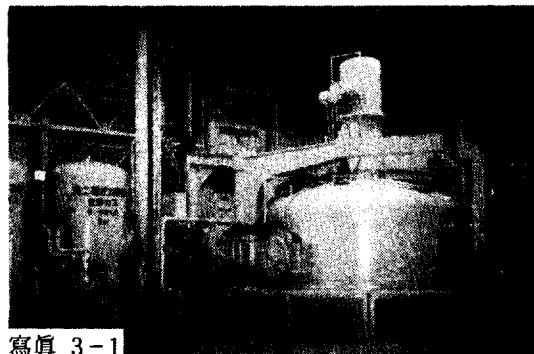
Be-Cu合金의 處理도 이 爐에서 行할 수 있다.

4) Ti, Zr의 烧鈍爐

Ti, Zr 및 이들의 合金은 H₂, O₂, N₂와 親和力이 매우 강하므로 雾圍氣爐에서 處理했을 경우 酸洗가 必要하였다.

이들의 金屬의 烧鈍에 必要한 真空度는 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ Torr이지만, 實用上 10^{-4} Torr이면 着色은 일어나지 않는다.

燒鈍溫度는 450~850°C이다. 真空加熱에 이은 脫GAS 후 Ar GAS導入하여, 材料의 昇溫冷却을 促進한다. 寫真 3-3에 Ti의 烧鈍爐를 보여준다.



寫真 3-1



寫真 3-2

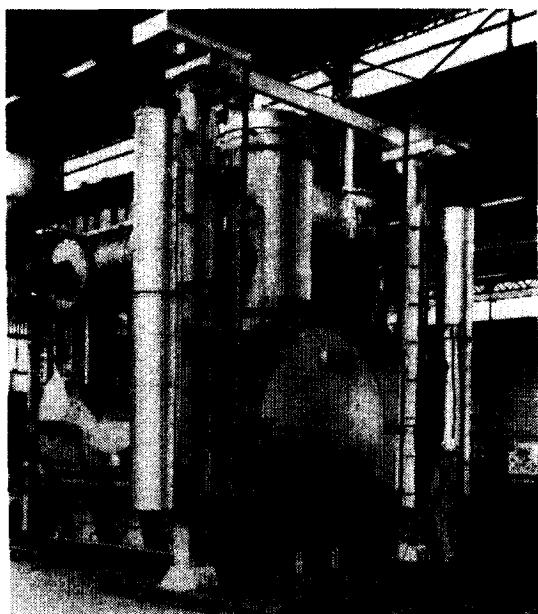


写真 3-3

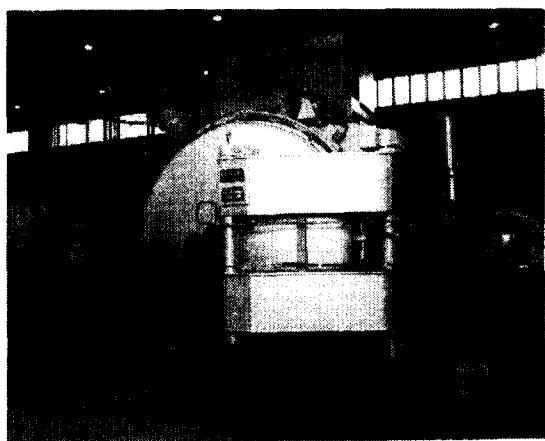


写真 4-1

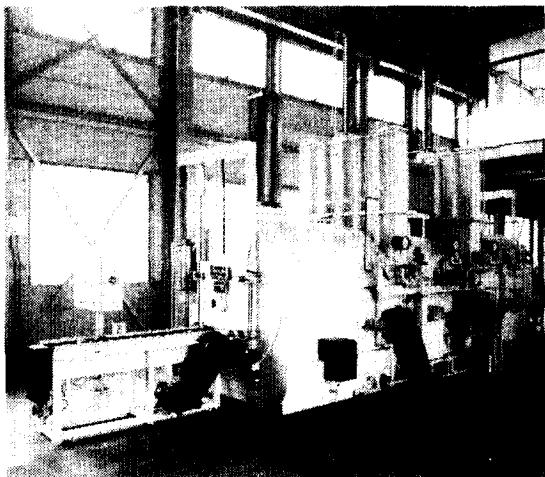


写真 4-2

4. 汎用型真空熱處理爐

工具鋼, 金型의 热處理를 主目的으로 開發된 爐이지만 납땜, 烧結, 烧鈍과 浸炭處理에도 使用된다. 使用溫度는 500~1350°C, 真空度는 10^{-2} Torr 정도가一般的이다.

1) 1室型真空爐(寫真 4-1)

加熱과 冷却을 同一室內에서 행하는 爐이다. 每回大氣에開放되기 때문에 O₂와 H₂O가 室內에 吸着하기 쉽다. 당사에서는 斷熱材에 비하여 O₂와 H₂O의 吸着이 적다.一般的으로 1室型의 경우擴散pump를 付屬하는 것이 많다.

冷却GAS莊은 CLUTCH-DOOR를 채용하여 最大 5 kgf/cm²abs까지 製作可能하다.

2) 2室・3室型真空爐

加熱과 冷却은 別室에서 行한다.

加熱室과 冷却室은 中間DOOR로 真空斷熱SEAL한다. 冷却GAS는 冷却室에만 導入하기 때문에 加熱室을 每回 冷却할 必要가 없고, 經濟性이 뛰어나다. 특히 3室型은 冷却時의 대기時間이 없고, 加熱만의 CYCLE이 連續處理 가능하므로 自動車部品과 SUS部品의 大量生產에 적합하다.

이 機種은 標準化된 機種이며, SIZE의 組合도 풍부히 갖추고 있다. 圖 4-1, 寫真 4-2는 代表的인 3室型爐를 보여준다. 工具鋼, 合金鋼, STAINLESS 鋼의 소입 및 烧結, Brazing, 溶體化 등에 널리 사용된다.

3) 低溫真空爐(寫真 4-3)

燒戾와 烧鈍用으로 使用되는 爐로서 水冷壁을 없앤 真空爐이다. 低溫域(150~750°C)에서 真空加熱(輻射加熱)할 경우, 材料의 异溫이 늦어진다. 이 爐는 真空 PURGE後 GAS를 導入하여 加熱, 冷却을 行하고 이때 吸着된 O₂와 H₂O의 影響을 막기 위해 HOT-WALL을 採用하고 있다.

4) 真空浸炭爐(寫真 4-4)

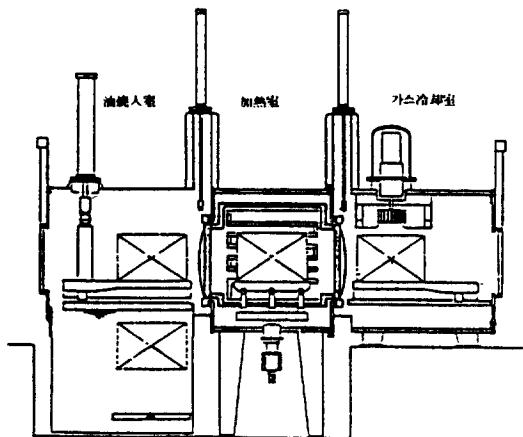
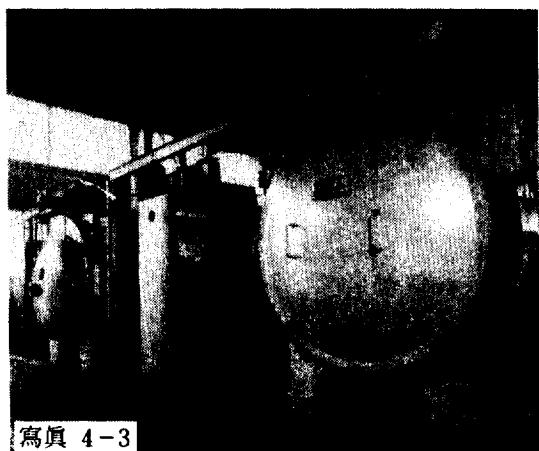


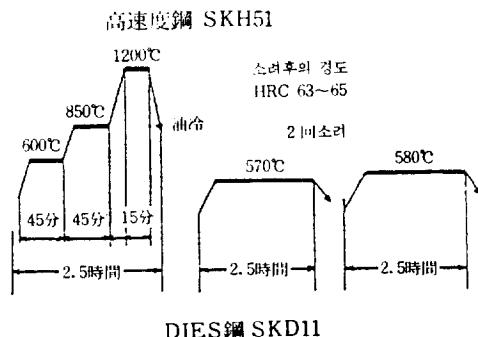
図 4-1



寫真 4-3



寫真 4-4



[標準型真空炉에 의한 热处理의 一例]

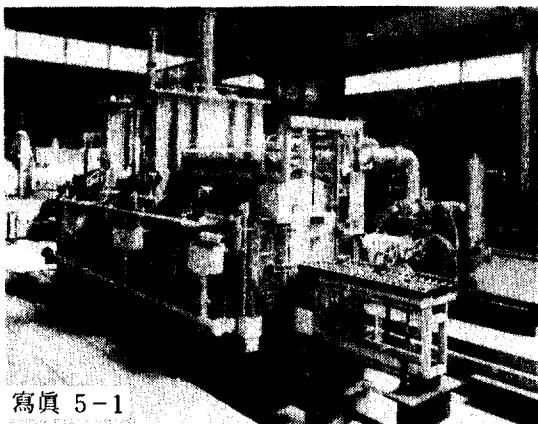
SEASONING이 不要한 浸炭專用爐를 寫真 4-4에서 보여준다. GAS 浸炭爐에 비해 設備費는 높지만 高溫浸炭이 可能하고 停爐後의 再 승온시 SEASONING이 不要하므로 每週停爐하는 경우에 적합하다.

5. 真空焼結爐

超硬合金의 烧結 鐵系 및 SUS系壓粉體의 烧結, 기타 대부분의 烧結에 「真空」을 利用할 수 있다. 烧結過程에서의 級密化의 機構는 材料에 따라 달라서 固相燒結, 液相燒結로 대별된다.

따라서 烧結에 있어서는 이들의 機構에 맞는 雰圍氣條件가 必要하다. 예를 들어 液相燒結에는 金屬의 蒸發을 防止하기 위하여 爐內의 真空度를 一定以上으로 하지 않으면 안된다.

超硬合金의 烧結은 1400~1600°C 0.1~0.5 Torr程度의 真空中에서 행해지며 爐形으로는前述의 汎用型真空爐와 같은 것이 이용된다. 鐵系, SUS系도 同型의 것이



寫真 5-1

이용되지만 溫度는 1100~1400°C이다.

寫真 5-1에 보인 爐는 脫 WAX處理, 燒結處理를 連續的으로 행하는 것으로서 自動車의 ENGINE 部品用 燒結爐로서 많이 사용되고 있다.

射出成形法은 PLASTIC과 같이 可望性이 높은 材料의 成形에 이용되고 있고, 最近에는 TURBO



寫真 5-2

CHARGER와 같은 複雜한 形狀을 한 CE RA MICS 部品의 成形法으로서 注目되고 있다. 大量生產에 적합한 方法이지만 原料에 多量의 樹脂(WAX)를 混合하여 成形하기 때문에 燒結에 앞서 注意깊게 脱脂할 必要가 있다. 寫真 5-2에 射出成形品의 脱脂·燒結用設備의 例를 보였다. 이 設備에서는 制御와 生產管理에 COMPUTER를 利用하고 있다.

6. 標準真空爐의 構造와 特徵

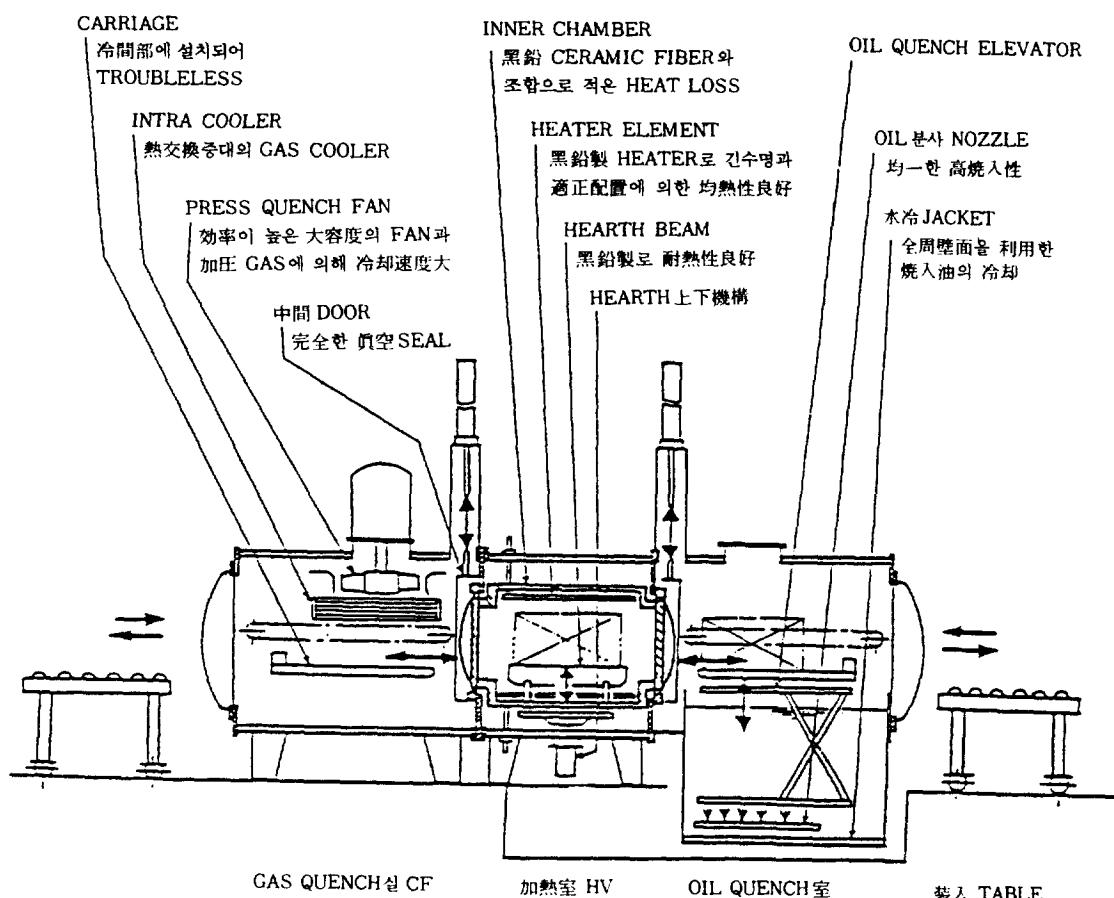
1) 機能과 構造

아래 그림은 3室型의 PRESS QUENCH真空熱處理爐를 보여준다.

이 爐는 加熱된 處理材가 OIL QUENCH室 또는 GAS QUENCH室에 移送되면 즉각 또 한편의 방에서 準備待機하고 있던 다음의 처리재를 加熱室에 裝入하는 것이 가능하므로 冷却대기에 의한 時間 및 ENERGY

LOSS가 없다. 이 때문에 多品種多量生產에 적합하다.

또 少品種多量生產에는 STRAIGHT-THROUGH의 3室型爐의 前後에 自動CONVEYOR를 설치하여 洗淨, 烧戻 등의 前後裝置와 直結하여, 省力化한 例도 있다. OIL QUENCH室의 上部에 冷却FAN, COOLER등의 GAS QUENCH裝置를 설치한 2室型真空熱處理爐(QF型)는 热處理專業工場은 물론 自社治工具의 鹽浴處理로부터 轉換하기 위하여 設備導入하는 MAKER등 여러 分野의 USER로부터 需要가 많은 機種이다.

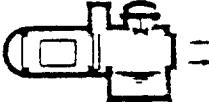


3室型 PRESS QUENCH真空爐의 構造

2) 標準機種과 시방

機種은 表와 같이 加熱室, VESTIBULE OIL QUENCH 室등 基本 MODULE 의 組合에 의해 處理目的에 맞는 選擇이 가능하고 各機種마다 5 등급의 SIZE 를 標準화하고 있다.

표준화한 VESTIBULE (GAS QUENCH실), 가열실, OIL QUENCH실을 조합하여 처리재, 처리目的에 최적의 구성을 선택할 수 있다.

CF		GAS냉각전용이다. PRESS QUENCH 실을 별도로 설치하여 냉각시간의 단축과 ENERGY절약을 도모하였다.
QF		GAS냉각과 유소입이 1실에서 가능한 겸용로이다. 두개의 기능이 COMPACT하게 짜여져 작은 SPACE에서 다품종을 처리하는데 最適이다.
CF-Q		GAS냉각과 유소입을 각각 別室에서 행할 수 있다. 다품종처리에 적합하며 STRAIGHT TROUGH형으로 하여 연속조업도 가능하다.
CF-C		GAS냉각 전용의 STRAIGHT-THROUGH 형으로서 연속처리에 最適이다.
QF-C		GAS냉각, 유소입 겸용의 STAGHT-THROUGH형으로서 다품종의 연속처리에 最適이다.

표준시방

SIZE	有効 치수 幅×길이×높이	最大裝入量 GROSS kg	加熱用電力 KW	動 力 KW*	N ₂ GAS使用量* m ³ /CYCLE	冷却水* Ton/h	SPACE 幅×길이×높이
10	300×500×300	100	40	30	2.5	5	5.5×7.5×3.5
20	460×610×300	200	60	40	5.0	8	6.0×8.0×3.8
30	610×920×460	450	105	55	9.0	12	6.5×9.5×4.6
40	610×920×610	520	130	70	12.5	14	7.0×10.0×5.0
50	760×1220×610	650	210	100	14.6	22	7.5×11.5×5.0

*QF TYPE의 경우